

系統簡介:

- 設備名稱: 鎢金屬化學氣相沉積系統(WCVD)
- 廠牌: APPLIED MATERIALS
- 型號: MCVD Centura WxZ
- 設備功能:
  - Deposition Film

Chamber-A : W (tungsten)

沉積速率 : >3000A/min

Rs : <210mOhm/SQ (<W film 5000A)

U% : <5%

Stress : <1.8e10 dyne/cm<sup>2</sup>

- Wafer Size : <8"

